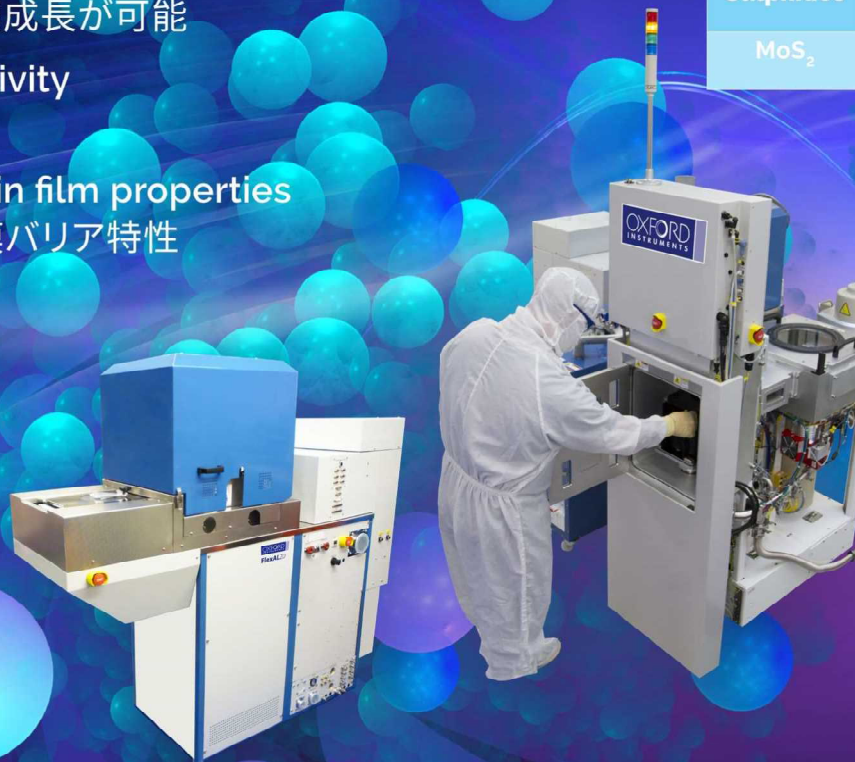


Atomic Layer Deposition

- **Wide range of materials**
幅広い材料の選択が可能
- **Excellent process control**
優れたプロセス制御
- **Up to 200mm**
Max. 200mmのウェハーに対応
- **Excellent step coverage**
優れたカバレッジ
- **Virtually pin-hole free films**
ピンホールの低減
- **Low film impurities**
膜中の不純物が少ない
- **Growth at room temperature**
室温での膜成長が可能
- **Low resistivity**
低抵抗
- **Superb thin film properties**
優れた薄膜バリア特性

Metals	Oxides	Nitrides
Pt	Al ₂ O ₃	AlN
Ru	Co ₃ O ₄	GaN
	Ga ₂ O ₃	HfN
Fluorides	HfO ₂	NbN
AlF ₃	In ₂ O ₃	Si ₃ N ₄
MgF ₂	Li ₂ CO ₃	TaN
	MoO ₃	TiN
Sulphides	Nb ₂ O ₅	WN
MoS ₂	NiO	
	SiO ₂	
	SnO ₂	
	Ta ₂ O ₅	
	TiO ₂	
	WO ₃	
	ZnO	
	ZrO ₂	



FlexAL®